

Siウエハ表面のAFM観察

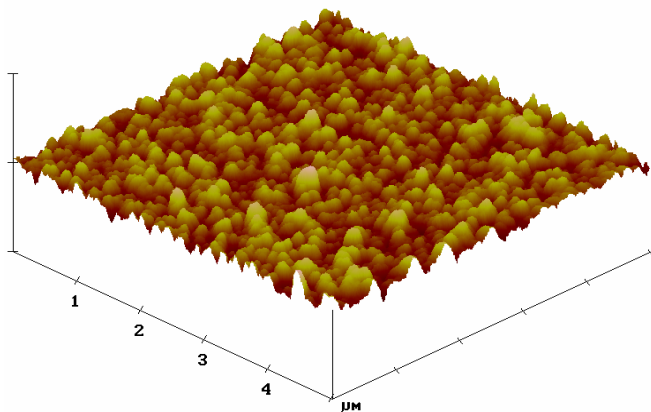


<分析手法>AFM(原子間力顕微鏡)による表面微細粗さ観察

AFM観察では、粗さの可視化のみならず、数値化が可能となります。SEM観察等では判別できないプラズマ処理条件によるSiウエハの微細な表面粗さの違いを、AFMにより調べました。

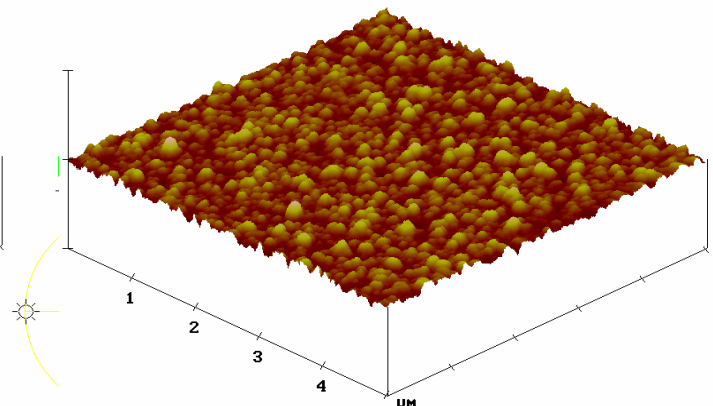
<結果>

処理条件1では処理条件2に比べて約1.7倍の粗さを有することがわかりました。



処理条件1

Ra: 4.56nm



処理条件2

Ra: 2.69nm

AFMによる表面粗さ観察結果

* Ra: 算術平均粗さ